

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公表番号】特表2015-534279(P2015-534279A)

【公表日】平成27年11月26日(2015.11.26)

【年通号数】公開・登録公報2015-074

【出願番号】特願2015-537703(P2015-537703)

【国際特許分類】

H 05 K 3/10 (2006.01)

H 05 K 3/34 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/10 C

H 05 K 3/34 5 0 5 B

【手続補正書】

【提出日】平成28年2月5日(2016.2.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

　　ウィスカー発生金属を含む表面における金属ウィスカー(15)の形成を低減する方法であって、

　　少なくとも1つの電磁エネルギー源から電磁エネルギーを出射させることによって、ウィスカー発生金属が配置された放射場を形成すること、

　　前記電磁エネルギーの前記出射に関連したパラメータを制御すること、とを含み、前記パラメータは、電磁エネルギーの周波数、振幅、出力レベル、及び、前記出射の期間を含む、方法。

【請求項2】

　　電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、連続的に電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも1つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

　　電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、周期的なスケジュールに従って電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも1つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

　　電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、約1ワットのテラヘルツ出力の電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも1つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項1のいずれかに記載の方法。

【請求項5】

　　電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、单一の周波数で電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも1つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項1～4のいずれかに記載の方法。

【請求項6】

　　電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、一組の異なる周波数で電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも1つの電磁エネルギー源を制御するこ

とをさらに含む、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の方法。

【請求項 7】

ハウジング(32)に電磁エネルギーを印加するための装置であって、前記装置は、
ウィスカ-発生金属を含む電子部品(27)を収容する前記ハウジング(32)に電磁
エネルギーを与えるように配置された少なくとも1つの電磁エネルギー源と、

前記少なくとも1つの電磁エネルギー源からの電磁エネルギーの出射を制御するための
コントローラー(55)とを含み、前記出射は、前記電磁エネルギーの周波数、振幅、出
力レベル、及び、前記出射の期間を含むパラメータに基づく、装置。

【請求項 8】

前記少なくとも1つの電磁エネルギー源は、テラヘルツエミッター(35)である、請
求項7に記載の装置。

【請求項 9】

前記テラヘルツエミッター(35)は、ホーン型アンテナ(40)を含む、請求項8に
記載の装置。

【請求項 10】

前記テラヘルツエミッター(35)は、量子カスケードレーザー(45)を含む、請
求項8又は9に記載の装置。

【請求項 11】

前記テラヘルツエミッター(35)は、クーラー(50)を含む、請求項8 ~ 10のい
ずれかに記載の装置。